論文題目 小型高感度な力検出ピエゾ抵抗型カンチレバー

氏 名 宇佐美 貴徳

第1章 序論

A.D. /

本研究の目的は、従来研究よりも小型かつ、高感度に力の検出が可能なピエゾ抵抗型カンチレバーを実現することである。研究対象とするピエゾ抵抗型カンチレバーを図1に示す。主としてカンチレバー頭部で力Fや 圧力Pを受け、脚(図1のLegと示した箇所)に歪 ε が生じる。この歪 ε に比例して抵抗値Rが変化し、歪 ε が 生じる前後の抵抗値をR及び $R + \Delta R$ とすると、加えられる力ごとに抵抗変化率 $\Delta R/R$ [·]が得られる。1Nあたりの抵抗変化率 $\Delta R/R/F$ [N·1]を力に対する感度とし、式(1)のように、 $\Delta R/R/F$ [N·1]は1Nあたりの歪 ε/F に比例し、これは脚長lに比例し、脚幅wと厚さtの二乗に反比例する。また1 Pa あたりの抵抗変化率 $\Delta R/R/P$ [Pa·1]を圧力に対する感度とし、式(2)のように、 $\Delta R/R/P$ [Pa·1]は1 Pa あたりの歪 ε/P に比例し、 これは脚長lと頭部面積Aに比例し、脚幅wと厚さtの二乗に反比例する。式(1)右辺と式(2)右辺を Scale factor と称する。小型化しても力に対し高感度な設計を Scale factor から検討する。なお本研究では、実験の再現性を理由として加える力は圧力Pとするが、頭部長l2 $\varepsilon l'$ とした場合に、l+l'のカンチレバー頭部中心に力Fが加わったと仮定して、 $\Delta R/R/F$ 及び $\Delta R/R/P$ と Scale factor との関係を研究する。

$$\frac{\Delta R/R}{F} \propto \frac{\varepsilon}{F} \propto \frac{(l+l')}{w \cdot t^2}$$
(1)

$$\frac{\Delta R}{P} \propto \frac{\varepsilon}{P} \propto \frac{A \cdot (l+l')}{w \cdot t^2}$$
(2)

ピエゾ抵抗型カンチレバーを用いて力を検出した報告は多岐にわたり、AFM(Atomic Force Microscopy)や 酵素基質間の結合力検出、圧力変化を利用した加速度、角加速度、気圧や差圧、風速のセンシングが挙げられ る。カンチレバーを小型化すれば、微小な計測対象や微小空間における力の計測が可能となる。また圧力に対 してはカンチレバー周囲からの空気の漏れ量が課題であったが、小型化によりカンチレバーの周の距離が短く なることで漏れ量の低減が可能となる。カンチレバーを幾何学的に相似に小型化した場合、圧力に対する感度 は変わらないが、カンチレバー形状をパターニングする精度、また厚さtの縮小に応じて、カンチレバー表面 から浅いドーピングによるピエゾ抵抗層の形成が課題となる。また力Fに対する感度については小型化によ り感度は向上するが、これについてもカンチレバー形状のパターニングの精度とドーピングが課題となる。本 論では、この技術的な課題に対し、金属蒸着膜を利用した FIB 加工法という提案手法により、理論的に検討 をした小型高感度な寸法の設計値に近い実寸で、ピエゾ抵抗型カンチレバーの試作を試みている。

試作したカンチレバーについて、厚さ 72 nm のピエゾ抵抗型カンチレバーを熱拡散ドーピングで実現し、 スタティックな力に対する動作を確認している。また主として圧力が加わる頭部面積 A が 100~400 µm²であ りながら、脚幅 w をサブミクロンとした場合の、寸法と感度との関係について研究を行った。このようなスケ ールにおいて、スタティックな力に対する研究はこれまで十分行われてこなかった。本研究を通して、従来研 究されてこなかったスケールも含め、小型高感度な力検出ピエゾ抵抗型カンチレバーを実現するための、再利 用可能な知識の提示を目指す。

第2章 理論と設計

小型高感度な設計を理論的に検討した。とくに厚さt=72 nm、100 nm、150 nm、205 nm に対し、それぞれ脚幅t=0.5 µm, 1.0 µm, 1.5 µm のピエゾ抵抗型カンチレバーの試作を検討した。各厚さに対し 935 °C, 40 sec の熱拡散で不純物(リン)をドーピングし、従来研究及び SIMS(Secondary Ion Mass Spectrometry)分析の結果から、カンチレバー表面から 32 nm 付近(不純物濃度 3×10¹⁹ [atoms/cc]程度)までをピエゾ抵抗層としての有効深さと仮定した。またカンチレバーに圧力 P=1Pa 及び 20 Pa を加えたときに、脚に歪 ε が生じることをシミュレーションで確認した。

第3章 金属蒸着膜を用いた FIB ナノ加工の提案手法と製作

本研究では小型高感度を実現する寸法の設計値に近い実寸で、ピエゾ抵抗型カンチレバーを試作するための 提案手法を示している。具体的には図4に示すとおり、まず SOI のデバイス層に Au を真空蒸着したウェハ を用意する。このウェハに対し予め加工領域を特定するパターニングを行った上で、FIB(Focused Ion Beam) を用いて目的とする加工領域の FIB 像を取得する(図4(1))。次にこの領域に対し、Au 層を介してデバイ ス層がカンチレバー形状にエッチングされるよう、FIB 加工を行った(図4(2))。加工後、カンチレバー上 部の Au 層を除去し(図4(3))、直下の Handle Si 層及び BOX 層のエッチングを行った(図4(4))。Au 蒸 着膜を用いた FIB 観察及び加工を行うことにより、デバイス層に対する不必要な Ga の注入を防ぎ、最終的 に圧力に対する抵抗変化率 $\Delta R/R$ [-]が得られることを確認した。Au 蒸着膜を介さない場合には抵抗変化は得 られなかった。また Au 層を加工したときの加工幅が 35 nm であったのに対し、カンチレバー上部の Au 層除 去後の、デバイス層の加工幅は 20 nm であった。これは FIB のビーム強度はプローブの中心ほど高く、中心 から外れるほど正規分布に従い強度が低下するという、FIB の特徴によるものである。すなわち、試料面に対 して完全な垂直加工とならない特徴を活かし、加工幅 20 nm を実現した。これにより 5~7 nm の誤差の精度 で、寸法の設計値に近い実寸によるカンチレバー形状のパターニングに成功した。カンチレバー形状に加工し た後の脚幅と加工幅を図5 に、最終的に完成させたピエゾ抵抗型カンチレバーの SEM 画像を図 6 に示す。

第4章 実験と考察

ピエゾ抵抗型カンチレバーに圧力を加える実験を行った。図 2 の概略図及び図 3 の実験セットアップに示 すとおり、カンチレバー上下面に配置したチャンバーを介して、圧力校正器から生じさせた圧力をカンチレバ ーに加える実験を行った。一例として Table 1 の(o)のカンチレバーに対し、1 Pa の圧力を加えたときの波形 を図 7 に、圧力と抵抗変化率 $\Delta R/R$ [·]との関係を図 8 に示す。Scale factor と感度の関係であるが、厚さ*t*ご とに両者の関係は一直線上に沿う結果が得られた。これに対し、従来研究及び SIMS 分析を行った結果(図 11)、3×10¹⁹ [atoms/cc]の不純物濃度に対応するピエゾ抵抗層の有効深さを 32 nm とした場合の定数 t_p =64 nm を、式(1)右辺に{1-(t_p/t)}として乗算し、{ $((l+l')/(wt^2)$ }·{1-(t_p/t)}を Scale factor とした。また式 (2)についても{ $A \cdot (l+l')/(wt^2)$ }·{1-(t_p/t)}を Scale factor とし、 $\Delta R/R/P$ との関係を確認した(図 12)。 ピエゾ抵抗層の有効深さを 26 nm~35 nm まで 3 nm 刻みで値を振った結果、誤差はあるが 32 nm の条件に おいて、圧力 P と力 F ともにカンチレバーの厚さt によらず、図中の各点は一直線上に沿う関係としてまと められた。各点は Table 1 に示した寸法の実測値をこの Scale factor の各パラメータに代入し、 $\Delta R/R/P$ との関係を示した結果である。 試作したピエゾ抵抗型カンチレバーの寸法と感度について、Table 1 (i)の条件において感度 $\Delta R/R/P$ =5.8×10⁻⁴ [Pa⁻¹]となり、従来研究よりも全長比 1/5.5 倍、脚幅比A=1/40 倍、厚さ比 1/2.8 倍と小型化を行った結果に対し、圧力Pに対する感度 $\Delta R/R/P$ は従来感度比で 4.4 倍の向上、力Fに対する感度 $\Delta R/R/F$ は 99.2 倍の向上となった。従来よりも小型高感度な力検出ピエゾ抵抗型カンチレバーが実現できたといえる。

また本研究で試作したカンチレバーの厚さ*t*=72 nm, 100 nm, 150 nm, 205 nm において、厚さ*t*以外同程度 の条件の場合(*w*=0.5 µm, *l*=2.5~2.7 µm, *l*'=10 µm, *A*=400 µm²の寸法は共通)、厚さ*t*=100 nm が最 も感度が高い結果となった(図 12 の(a), (i), (l), (o)の比較)。厚さ*t*=100 nm の場合、2×10¹⁹ [atoms/cc]以下 の不純物濃度が中立面以下にドープされているが、これは感度に対して支配的とは言えないと推察される。厚 さ*t*=150 nm, 205 nm の場合、中立面以上に 2×10¹⁹ [atoms/cc]程度の濃度の不純物が存在するが、材料力学 としての強さが、厚さ*t*=100 nm よりも感度を低下させたものと考えられる。厚さ*t*=72 nm の場合、中立面 以下 2~3×10¹⁹ [atoms/cc]の不純物濃度が感度に対し、負に寄与していたと考えられる。脚幅 *w*=0.5 µm、 1.0 µm、1.5 µm について、それぞれの厚さ*t*ごとに感度との関係を調べた結果、感度の実測値は理論値に沿 うことを確認した(図 9、図 10)。

第5章 結論

本研究を通して、従来よりも小型かつ高感度に力を検出するピエゾ抵抗型カンチレバーを実現した。カンチ レバーを小型化した場合に、寸法の設計値に近い実寸で試作を行う技術的な課題に対し、提案手法として金属 蒸着膜を利用したFIB観察及びナノ加工法を示した。最小加工幅20 nmでのカンチレバー形状のパターニング を行い、寸法の設計値に近い実寸でピエゾ抵抗型カンチレバーの試作に成功した。カンチレバーに力を加える 実験を行った結果、感度の実測値は理論値に沿っていた。またSIMS分析から確認を行ったピエゾ抵抗層の有 効深さと、カンチレバーの厚さについて、感度とScale factorの関係から高感度を実現する条件について考察 を行った。製作と実験の再現性、感度の実測値が理論値に沿っていたこと、本研究のスケールにおいて感度は Scale factorと比例関係にあったことから、本研究を通して、小型高感度なピエゾ抵抗型カンチレバーを実現 するための再利用可能な知識を提示できたものと考えている。